

水处理设备【半导体、显像管、光学产品等制造业用纯水】

产品名称	水处理设备【半导体、显像管、光学产品等制造业用纯水】
公司名称	上海沧浪源水处理工程有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	型号:RO EDI 操作压力:0.5 (Mpa) 水电阻率:18
公司地址	上海市奉贤区四团镇横河路8号131室
联系电话	021-54363500 18721520412

产品详情

型号	RO EDI	操作压力	0.5 (Mpa)
水电阻率	18	出水量	100
电压	380 (V)	功率	30000 (w)
电导率	0.06	脱盐率	98 (%)
单机出力	100 (/h)	品牌	沧浪源

半导体、显像管、光学产品等制造业用纯水

半导体、显像管、光学产品等制造业用纯水

半导体清洗超纯水设备水质标准：

半导体芯片清洗超纯水设备出水水质完全符合美国astm纯水水质标准、我国电子工业部电子级水质技术标准 (18m .cm、15m .cm、10m .cm、2m .cm、0.5m .cm五级标准)、我国电子工业部高纯水水质试行标准、美国半导体工业用纯水指标、日本集成电路水质标准、国内外大规模集成电路水质标准。

新兴的光电材料生产、加工、清洗；lcd液晶显示屏、pdp等离子显示屏、高品质灯管显像管、微电子工业、fpc/pcb线路板、电路板、大规模、超大规模集成电路需用大量的高纯水、超纯水清洗半成品、成品。集成电路的集成度越高，对水质的要求也越高，这也对超纯水处理工艺及产品的简易性、自动化程度、生产的连续性、可持续性提出了更加严格的要求。

半导体清洗超纯水设备制备工艺：

1、预处理系统 反渗透系统 中间水箱 精混合床 纯水箱 纯水泵 紫外线杀菌器 抛光混床 精密过滤器 用水对象 (15m .cm) (传统工艺)

2、预处理 反渗透 中间水箱 水泵 edi装置 纯水箱 纯水泵 紫外线杀菌器 抛光混床 0.2或0.

5 μm精密过滤器 用水对象 (16m .cm) (最新工艺)

3、预处理 一级反渗透 加药机 (ph调节) 中间水箱 第二级反渗透 (正电荷反渗透) 纯水箱
纯水泵 edi装置 紫外线杀菌器 0.2或0.5 μm精密过滤器 用水对象 (17m .cm) (最新工艺)

半导体清洗超纯水设备应用场合：

电解电容器生产铝箔及工作件的清洗 电子管生产、电子管阴极涂敷碳酸盐配液

显像管和阴极射线管生产、配料用纯水

黑白显像管荧光屏生产、玻壳清洗、沉淀、湿润、洗膜、管颈清洗用纯水

液晶显示器的生产、屏面需用纯水清洗和用纯水配液

晶体管生产中主要用于清洗硅片，另有少量用于药液配制

集成电路生产中高纯水清洗硅片

半导体材料、器件、印刷电路板和集成电路

lcd液晶显示屏、pdp等离子显示屏

高品质显像管、萤光粉生产

半导体材料、晶元材料生产、加工、清洗

超纯材料和超纯化学试剂、超纯化工材料

实验室和中试车间

汽车、家电表面抛光处理

光电产品、其他高科技精微产品